

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成22年2月25日(2010.2.25)

【公開番号】特開2008-233598(P2008-233598A)

【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)

【年通号数】公開・登録公報2008-039

【出願番号】特願2007-74144(P2007-74144)

【国際特許分類】

G 09 F 9/00 (2006.01)

G 02 F 1/1368 (2006.01)

G 02 F 1/13 (2006.01)

【F I】

G 09 F 9/00 3 3 8

G 02 F 1/1368

G 02 F 1/13 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成22年1月9日(2010.1.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の面側にトランジスタが形成された第1の基板と、該第1の基板の前記第1の面に對向する第2の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、

前記第1の基板における前記第1の面と反対側の第2の面において、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第1の領域を避ける第2の領域の所定の位置に、2次元バーコードが形成されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】

第1の面側にトランジスタが形成された第1の基板と、該第1の基板の前記第1の面に對向する第2の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、

前記第1の基板における前記第1の面と反対側の第2の面に、第3の基板が貼着されており、

前記第3の基板における前記第1の基板に貼着された第3の面と反対側の第4の面において、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第1の領域を避ける第2の領域の所定の位置に、2次元バーコードが形成されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項3】

前記所定の位置は、前記第1の基板の前記第1の面側に形成された上下導通端子と重なる位置であることを特徴とする請求項1または2に記載の電気光学装置。

【請求項4】

前記所定の位置は、前記第1の基板の前記第1の面側に形成された外部接続端子と重なる位置であることを特徴とする請求項1または2に記載の電気光学装置。

【請求項5】

前記第1の基板の前記第1の面側に、前記トランジスタを前記第2の面側から平面視した状態で覆って遮光する遮光膜が形成されており、

前記遮光膜の一部が、前記第2の領域の前記所定の位置において島状に形成されていることを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の電気光学装置。

【請求項 6】

前記 2 次元バーコードは、前記第 1 の基板の製造ナンバーと、前記第 1 の基板が構成される大板の製造ナンバーと、複数枚の前記大板を 1 組にした組毎の製造ナンバーとを表していることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の電気光学装置。

【請求項 7】

第 1 の面側にトランジスタが形成された第 1 の基板に、前記第 1 の面に対向するよう第 2 の基板を貼り合わせる貼着工程と、

前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に、電気光学物質を介在させる電気光学物質介在工程と、

前記第 1 の基板を該第 1 の基板が構成された大板から分断する分断工程と、
を具備し、

前記電気光学物質介在工程後、前記分断工程に先立って、前記第 1 の基板の前記第 1 の面と反対側の第 2 の面に対し、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第 1 の領域を避ける第 2 の領域の所定の位置に、2 次元バーコードを形成する 2 次元バーコード形成工程を具備していることを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 8】

第 1 の面側にトランジスタが形成された第 1 の基板に、前記第 1 の面に対向するよう第 2 の基板を貼り合わせる第 1 の貼着工程と、

前記第 1 の基板の前記第 1 の面と反対側の第 2 の面に、第 3 の基板を貼り合わせる第 2 の貼着工程と、

前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に、電気光学物質を介在させる電気光学物質介在工程と、

前記第 1 の基板及び前記第 3 の基板を、前記第 1 の基板及び前記第 3 の基板が構成された各大板からそれぞれ分断する分断工程と、

を具備し、

前記電気光学物質介在工程後、前記分断工程に先立って、前記第 3 の基板の前記第 1 の基板に対向する第 3 の面と反対側の第 4 の面に対し、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第 1 の領域を避ける第 2 の領域の所定の位置に、2 次元バーコードを形成する 2 次元バーコード形成工程を具備していることを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 9】

前記第 1 の基板の前記第 1 の面側に前記トランジスタを形成するに先立って、前記トランジスタを前記第 2 の面側から平面視した状態で覆って遮光する遮光膜を前記第 1 の面側に形成する工程を具備し、

前記遮光膜を形成する工程において、前記第 2 の領域に形成される前記 2 次元バーコードを平面視した状態で覆う位置に、前記遮光膜の一部を島状に形成することを特徴とする請求項 7 または 8 に記載の電気光学装置の製造方法。

【請求項 10】

請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の電気光学装置を具備することを特徴とする電子機器。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

上記目的を達成するために本発明に係る電気光学装置は、第 1 の面側にトランジスタが形成された第 1 の基板と、該第 1 の基板の前記第 1 の面に対向する第 2 の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、前記第 1 の基板における前記第 1 の面と反対側の第 2 の面において、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第 1 の領域を避ける第 2 の領域の所定の位置に、2 次元バーコードが形成されていることを特徴とす

る。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

また、第1の面側にトランジスタが形成された第1の基板と、該第1の基板の前記第1の面に対向する第2の基板との間に電気光学物質が介在された電気光学装置であって、前記第1の基板における前記第1の面と反対側の第2の面に、第3の基板が貼着されており、前記第3の基板における前記第1の基板に貼着された第3の面と反対側の第4の面において、平面視した状態で前記トランジスタが形成された第1の領域を避ける第2の領域の所定の位置に、2次元バーコードが形成されていることを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

さらに、前記所定の位置は、前記第1の基板の前記第1の面側に形成された上下導通端子と重なる位置でもよい。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

また、前記所定の位置は、前記第1の基板の前記第1の面側に形成された外部接続端子と重なる位置でもよい。